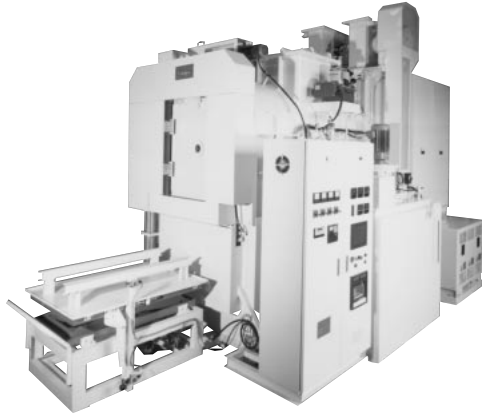


EVC 21 真空浸炭炉

EVC 21 Vacuum Carburizing Furnace



光洋サーモシステム(株)では、新しい真空浸炭技術を開発し、EVC 21 真空浸炭炉として完成・販売したので、ここにその概要を紹介する。

真空浸炭炉については、1977年に1号機を販売、研究開発を続けている。

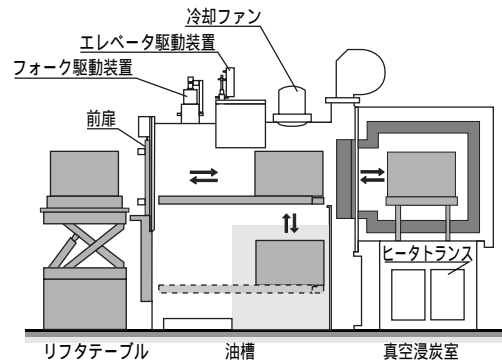
特長

- ・ 浸炭性ガスに不飽和炭化水素を用いたまったく新しい浸炭技術
- ・ 高温処理が可能で、従来炉に比べ浸炭時間が15～70%短縮
- ・ 処理時間短縮、炉殻放散熱量削減により、ランニングコストが40%削減
- ・ 製品の粒界酸化がなく、光輝性が改善
- ・ フレームカーテン、炉内排ガスの燃焼が不要になり、CO₂ガスの発生なし
- ・ フレームカーテンレスとなり、煤、熱気の発生がなく、作業環境が大幅に改善
- ・ シーズニング不要で、処理したい時に即立上げ可能(ジャストインタイム)
- ・ 独自のガス導入・排気方法の採用により、浸炭バラツキ小。浸炭プロセスガスの採用により浸炭ムラ、煤の発生を解消(特許出願中)

用途

- ・ 宇宙・航空機産業用精密部品、自動車産業部品等

略図



主な仕様

- 型 式：G-243624-19VQC
 - 加熱方式：電気抵抗加熱
 - 使用温度：最高 1050
：常用 800～1040
 - 最大挿入量：500kg / チャージ(グロス)
 - 有効寸法(mm)：W610 × D915 × H610
 - 使用ガス：エチレンガス、プロセスガス、N₂ガス
 - 操作圧力：9 kPa以下
 - 設備電力：170KVA
- 油槽ベスティブルに冷却ファン装備により、高温浸炭後の結晶粒の調整が可能。
信頼性の高いフォーク搬送装置を採用。
設備高さが低く、ピットレスも可能。
オプションでガス浸炭処理可能なハイブリット浸炭炉も可能。

光洋サーモシステム株式会社